

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 2 区分
 【発行日】平成 27 年 4 月 9 日 (2015.4.9)

【公表番号】特表 2014-523540 (P2014-523540A)
 【公表日】平成 26 年 9 月 11 日 (2014.9.11)
 【年通号数】公開・登録公報 2014-049
 【出願番号】特願 2014-514482 (P2014-514482)
 【国際特許分類】

G 0 3 F 7/004 (2006.01)

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

B 2 9 C 33/38 (2006.01)

【 F I 】

G 0 3 F 7/004 5 0 1

H 0 1 L 21/30 5 0 2 R

B 2 9 C 33/38

【手続補正書】

【提出日】平成 27 年 2 月 19 日 (2015.2.19)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

フォトレジストと、
 該フォトレジストに分散した二光子光開始剤系と、
 該フォトレジストに分散したポリマー連結ナノ粒子と、を含み、
 該ポリマー連結ナノ粒子が、ポリマーとナノ粒子との間の共有結合を含み、
露光されていない、組成物。

【請求項 2】

フォトレジスト、該フォトレジストに分散した二光子光開始剤系、及び該フォトレジストに分散したポリマー連結ナノ粒子を含むとともに、該ポリマー連結ナノ粒子が、ポリマーとナノ粒子との間の共有結合を含む、露光していない組成物を準備することと、

該露光していない組成物を走査レーザー光線に暴露させて、物品の形状に露光した組成物を形成することと、

該組成物を現像すること、とを含む、物品の製造方法。